

ランプアニール ユニット

【特徴】

- サークル形状の高出力赤外線ランプヒータを用いて基板の上下から加熱することで、急速加熱、高精度温度分布を実現
- チャンバー内面に特殊表面処理の冷却反射プレートを採用し、優れたプロセス再現性と、急速冷却が可能



【仕様】

- 処理基板：φ300mm
- 最高使用温度：1000±10℃
- 昇温速度：16.3℃/sec
- 処理環境：真空、あるいはArガス中